

PMT orders maskless lithography system from EV Group for advanced memory wafer probe card manufacturing - January 24, 2024

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. "Fine-pitch probe card manufacturing involves many lithographic patterning steps, which can significantly drive up cost of ownership." stated Dr. Yong-Ho Cho, CEO of PMT. Incorporating EVG's MLE™ (maskless exposure) technology, LITHOSCALE addresses lithography needs for markets and applications that require a high degree of flexibility or product variation. LITHOSCALE tackles legacy bottlenecks by combining powerful digital processing that enables real-time data transfer and immediate exposure, high structuring resolution and throughput scalability.

시군의회 정당	선권위 정치인순	간포칙 행사(문화	9}					
산업별 주	재별 지역별	상장사	사진				Q yes	ह क्षेत्र
- 메모리 위 템 발주	비이퍼 프로	브카드기	제조용의	으로 EV Gr	roup의 미	도스	리스 리	소
		용 증가시키는	는 미세 피치	프로브 카드에	최적			
출처: EVG								
	PROTE	future MEM	S Probe Card	EVG				
	메모리 위 템 발주 ® 마스크리스 I풍 믹스로 마.	메모리 웨이퍼 프로 템 받주 등 마스크리스 노랑 솔루션 등 믹스로 마스크 오너에드 비 솔처: EVG	메모리 웨이퍼 프로브 카드 : 램 발주 좋 마스크리스 노광 출표전 1물 믹스로 마스크 오너해드 비용 증가시키는 출처: EVG PROTEC Tourse Mail	메모리 웨이퍼 프로브 카드 제조용의 햄 발주 ☞ 마스크리스 노광 승무전 I몰 믹스로 마스크 오너에드 비용 증가시키는 미시 피지 승제. EVG PROTEC Nauro MBAS Proto Card	메모리 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 EV Gr 템 발주 또 마스크리스 노랑 출구전 문 익스로 마스크 오버예드 비용 증가시키는 미시 피치 프로브 카드에 술처: EVG	메모리 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 EV Group의 미 램 발주 해 마스크리스 노랑 승무전 1용 믹스로 마스크 오너헤드 비용 증가시키는 미시 피치 프로브 카드에 취직 승제: EVG Performing for Names Middle Print Card	메모리 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 EV Group의 마스크 캠 발주 18 막스로 마스크 오머에드 비용 증가시키는 미세 피치 프로브 카드에 하적 출처: EVG	메모리 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 EV Group의 마스크리스 리: 캠 발주 18 먹스로 마스크 오머에드 비용 증가시키는 미세 피치 프로브 카드에 하적 출처: EVG



피엽티(PRCTEC MEMS Technology)와 EV Group(EVG)은 심단 웨이퍼 메모리 프로브 키드 제조를 위한 마스크리스 리소그래피 공급 계약을 체결했다. 원북부터 조용호 피엽터 대표이사, 윤명식 EVG 한국지

서울~~(뉴스와이어)~~MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본당 및 리소그래퍼 장비 분야를 선도하는 EV 그룹(EV Group, 이 하 EVG)은 한국명 세계적인 번도체 웨이퍼 프로브 카드 선도 기업 피언티(PROTEC MEMS Technology)로부터 자사의 LITHOSCALE® 아스크리스 노랑 시스템에 대한 공급 계약을 수주했다고 밝혔다.

이번 계약으로 EVG의 LITHOSCALE 시스템은 피영티 본사(충납 아산시)에 쉽치해 참단 NAND, DRAM, 고대역목 메오리(HBM) 디 바이스의 웨이퍼 레벤 테스트용 차세대 MEMS 기반 프로브 카드 제조에 사용될 예정이다.

피엔티 조용호 대표이사는 "미시 피치 프로브 카드는 반복적인 리소그래피 패터닝 공정으로 제작해 체조 비용 증가 취소화가 필 묘하다"며 "기존 마스크 원라이너(Mask Alignen)를 이용한 리소그래피 공정을 EVG의 마스크리스(Maskless) 노광 장비인 UTHOSCALE트 대체함으로써 치조 비용 철인이 가능하고, 공정 개발 속도도 혁신적으로 단축할 수 있을 뿐만 아니라 프로세스 성능도 더 높면 수 입을 것으로 기대하고 있다. 원고로도 우리는 점단 프로브 카드 체조 및 개발에서 EVG의 UTHOSCALE뿐 아니 라 다양한 프로세스 솔루션을 통한 협력을 이야갈 것으로 기대한다"고 말했다.

EVG의 MLE[®](Maskless Exposure) 기술을 적용한 LTHOSCALE은 높은 수준의 유연성이나 제품 다양성이 필요한 시장 및 애플리 케이션의 리소그래피 묘구를 충족한다. LTHOSCALE은 실시간 데이터 전송과 즉각적인 노광을 가능하게 하는 강력한 디지털 프 토세상 승락과 높은 구조적 흔해놓 및 정신 처리량 해장성을 결합할으로써 기존 리소그래피 방식의 병목 문제를 해결한다. EVG 의 LTHOSCALE은 빠른 프로토타임 개발에 매우 이상적인 출루선으로, 턴이라운드 시간과 연구 개발 주기를 앞당길 수 있게 해 준다.

MEMS 제조는 특히 미사공장의 복잡성 태문에 공정 난도가 높으며, 그 결과 마스크 제조 비용 증가를 피할 수 없는 한체가 있다. 마스크를 사용하지 않는 UTHOSCALE은 높은 초점 업도와 교문해당Cam 수준의 LSLine & Septembolity Septembolity 에너머 아 스크를 사용하지 않고도 미시 패치 프로브 카드의 해석 기술인 고말은 채배선 레이어(RDL)와 비어(No) 연결을 가능하게 해준다.

EVG 한국지사의 운영식 지사장은 '피앤티가 자사 체풍 포트플리오를 휘장하고 개발 시간을 단축할 수 있도록 돕게 꽤 매우 가 빠다'며 '프로브 카드를 사용하는 웨이미 취별 테스트는 디마이스 성신 수용을 높이고, 디어안 컨빈적 테스트 비용을 낮추기 위 한 평수 공장이다. UTHOSCALE 실은 부행는, TOPM과 모양 제품 실제를 취직할 수 있는 뛰어난 유연상, 당은 소유 비용 특성 을 정압한 독장적인 솔루션으로, 미세 피쳐 웨이피 프로브 카드 제조용으로 매우 이상적'이라고 말했다.

https://www.reporternside.com/ press/?newsid=983108